# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 4月10日

出願番号

Application Number: 特願20

特願2001-111132

[ ST.10/C ]:

[JP2001-111132]

H 願 Applicant(s): O/A CO

日本電産リード株式会社

2002年 2月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



# 特2001-111132

【書類名】 特許願

【整理番号】 RD-0007-P

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01R 31/02

【発明者】

【住所又は居所】 京都府宇治市槙島町目川126番地 日本電産リード株

式会社内

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県滋賀郡志賀町小野朝日二丁目19番地3

【氏名】 山田 正良

【特許出願人】

【識別番号】 392019709

【氏名又は名称】 日本電産リード株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105935

【弁理士】

【氏名又は名称】 振角 正一

【選任した代理人】

【識別番号】 100105980

【弁理士】

【氏名又は名称】 梁瀬 右司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074492

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9905545

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

回路基板の検査装置および検査方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面 あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む 配線が複数個形成された回路基板の検査装置において、

前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つの端子部を選択し、その選択された端子部に電磁波を選択的に照射する電磁波照射手段と、

前記選択された端子部に近接して設けられた第1電極部と、

前記選択された端子部を含む検査対象配線の少なくとも一部に近接して設けられ、前記検査対象配線と容量結合された第2電極部と、

前記第1電極部と前記第2電極部との間に介挿され、前記第1電極部が前記第 2電極部より高電位となるよう電位差を与える電源と、

前記第2電極部から前記電源へ流れる電流と、前記電源から前記第1電極部へ 流れる電流とのうちいずれか一方の電流を検出する電流検出手段と、

前記電流検出手段によって検出された電流値に基づいて、前記検査対象配線の 導通状態を判定する判定手段と

を備えたことを特徴とする回路基板の検査装置。

【請求項2】 回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面 あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む 配線が複数個形成された回路基板の検査装置において、

前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つを選択し、その選択された 第1選択端子部に電磁波を照射した後、前記第1選択端子部と異なる別の端子部 を選択し、その第2選択端子部に電磁波を照射する電磁波照射手段と、

前記第1および第2選択端子部に近接して設けられた第1電極部と、

前記第1選択端子部を含む第1検査対象配線の少なくとも一部と、前記第2選 択端子部を含む第2検査対象配線の少なくとも一部とに近接して設けられ、前記 第1および第2検査対象配線のそれぞれと容量結合された第2電極部と、

前記第1電極部と前記第2電極部との間に介挿され、前記第1電極部が前記第

2 電極部より高電位となるよう電位差を与える電源と、

前記第2電極部から前記電源へ流れる電流と、前記電源から前記第1電極部へ 流れる電流とのうちいずれか一方の電流を検出する電流検出手段と、

前記電流検出手段によって検出された電流値に基づいて、前記第1および第2 検査対象配線の間の導通状態を判定する判定手段と

を備えたことを特徴とする回路基板の検査装置。

【請求項3】 回路基板の表面に形成された複数の端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記複数の端子部を相互に電気的に接続する導電部とを含む検査対象配線が形成された回路基板の検査装置において、

前記複数の端子部のうち少なくとも2つの端子部を選択し、その選択端子部に 順次、電磁波を選択的に照射する電磁波照射手段と、

前記複数の選択端子部に近接して設けられた第1電極部と、

前記検査対象配線の少なくとも一部に近接して設けられ、前記検査対象配線と 容量結合された第2電極部と、

前記第1電極部と前記第2電極部との間に介挿され、前記第1電極部が前記第 2電極部より高電位となるよう電位差を与える電源と、

前記第2電極部から前記電源へ流れる電流と、前記電源から前記第1電極部へ 流れる電流とのうちいずれか一方の電流を検出する電流検出手段と、

前記電流検出手段によって検出された電流値に基づいて、前記選択端子部の間 の導通状態を判定する判定手段と

を備えたことを特徴とする回路基板の検査装置。

【請求項4】 少なくとも前記選択された端子部と前記第1電極部の一部とを取り囲むチャンバをさらに備え、

前記電磁波照射の前に前記チャンバ内の減圧処理が行われ、その減圧状態で前 記電磁波が前記選択された端子部に照射される請求項1ないし3のいずれか1項 に記載の回路基板の検査装置。

【請求項5】 前記第1電極部が前記チャンバの一内側面を構成している請求項4に記載の回路基板の検査装置。

【請求項6】 前記第1電極部として、透明電極が用いられていることを特

徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の回路基板の検査装置。

【請求項7】 前記第1電極部として、メッシュ電極が用いられていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の回路基板の検査装置。

【請求項8】 前記回路基板には、前記検査対象配線と接続されていない少なくとも1つの配線が前記第2電極部として設けられるとともに、前記電源と電気的に接続されている請求項1ないし7のいずれか1項に記載の回路基板の検査装置。

【請求項9】 前記回路基板には、前記検査対象配線と接続されていない少なくとも1つの配線が前記第1電極部として設けられるとともに、前記電源と電気的に接続されている請求項1ないし7のいずれか1項に記載の回路基板の検査装置。

【請求項10】 前記回路基板には、前記検査対象配線と接続されていない 少なくとも1つの配線が前記第1電極部として設けられて前記電源の一方端子と 電気的に接続されるとともに、前記検査対象配線および前記第1電極部として用 いられている配線以外の少なくとも1つの配線が前記第2電極部として設けられ て前記電源の他方端子に電気的に接続されている請求項1ないし7のいずれか1 項に記載の回路基板の検査装置。

【請求項11】 回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査方法において、

前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つを選択し、その選択した端子部に近接して第1電極部を配置する第1工程と、

前記選択された端子部を含む検査対象配線と容量結合するように、前記検査対 象配線の少なくとも一部に近接して第2電極部を配置する第2工程と、

前記第1電極部が前記第2電極部よりも高電位となるように、前記第1電極部 と前記第2電極部との間に電位差を与える第3工程と、

前記選択された端子部に選択的に電磁波を照射する第4工程と、

前記第1電極部および前記第2電極部のいずれか一方に流れる電流を検出する 第5工程と、 前記第5工程において検出された電流値に基づき該検査対象配線の導通状態を 判定する第6工程と

を備えることを特徴とする回路基板の検査方法。

【請求項12】 少なくとも前記第4工程より前に、前記選択された端子部と前記第1電極部の少なくとも一部とを取り囲んで閉空間を形成し、前記閉空間を減圧状態とする第7工程をさらに備える請求項11に記載の回路基板の検査方法。

【請求項13】 前記第2工程は、前記検査対象配線と接続されていない少なくとも1つの配線を前記第2電極として選択する請求項11または12に記載の回路基板の検査方法。

【請求項14】 回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査方法において、

前記回路基板の表面に形成された端子部のうち2つを選択し、それら第1および第2選択端子部に近接して第1電極部を配置する第8工程と、

前記第1選択端子部を含む第1検査対象配線と、前記第2選択端子部を含む第2検査対象配線とがそれぞれ第2電極部との間で容量結合するように、前記第1 検査対象配線の少なくとも一部と前記第2検査対象配線の少なくとも一部とに近接して前記第2電極部を配置する第9工程と、

前記第1電極部が前記第2電極部よりも高電位となるように、前記第1電極部 と前記第2電極部との間に電位差を与える第10工程と、

前記第1選択端子部に電磁波を照射する第11工程と、

前記第11工程に続いて、前記第2選択端子部に電磁波を照射する第12工程 と、

前記電磁波の照射対象が前記第1選択端子部から前記第2選択端子部に切り替わるときに、前記第1電極部および前記第2電極部のいずれか一方に流れる電流を検出する第13工程と、

前記第13工程において検出された電流値に基づき前記第1検査対象配線と前 記第2検査対象配線との間の導通状態を判定する第14工程と を備えることを特徴とする回路基板の検査方法。

【請求項15】 少なくとも前記第11工程より前に、前記選択された第1 および第2端子部と、前記第1電極部の少なくとも一部とを取り囲んで閉空間を 形成し、前記閉空間を減圧状態とする第15工程をさらに備える請求項14に記 載の回路基板の検査方法。

【請求項16】 前記第9工程は、前記第1検査対象配線および前記第2検査対象配線と接続されていない少なくとも1つの配線を前記第2電極部として選択する請求項14または15に記載の回路基板の検査方法。

【請求項17】 回路基板の表面に形成された複数の端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記複数の端子部を相互に電気的に接続する 導電部とを含む検査対象配線が形成された回路基板の検査方法において、

前記回路基板の表面に形成された端子部のうち2つを選択し、それら第1および第2選択端子部に近接して第1電極部を配置する第16工程と、

前記検査対象配線と容量結合するように、前記検査対象配線の少なくとも一部 に近接して前記第2電極部を配置する第17工程と、

前記第1電極部が前記第2電極部よりも高電位となるように、前記第1電極部 と前記第2電極部との間に電位差を与える第18工程と、

前記第1選択端子部に電磁波を照射する第19工程と、

前記第19工程に続いて、前記第2選択端子部に電磁波を照射する第20工程 と、

前記電磁波の照射対象が前記第1選択端子部から前記第2選択端子部に切り替 わるときに、前記第1電極部および前記第2電極部のいずれか一方に流れる電流 を検出する第21工程と、

前記第21工程において検出された電流値に基づき前記検査対象配線の導通状態を判定する第22工程と

を備えることを特徴とする回路基板の検査方法。

【請求項18】 少なくとも前記第19工程より前に、前記第1および第2選択端子部と、前記第1電極部の少なくとも一部とを取り囲んで閉空間を形成し、前記閉空間を減圧状態とする第23工程をさらに備える請求項17に記載の回

路基板の検査方法。

【請求項19】 前記第17工程は、前記検査対象配線と接続されていない少なくとも1つの配線を前記第2電極部として選択する請求項17または18に記載の回路基板の検査方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

この発明は、回路基板に形成された複数の配線の電気的な状態を検査する検査 装置および検査方法に関するものである。なお、この発明は、プリント配線基板 、フレキシブル基板、多層配線基板、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ 用のガラス基板、ならびに半導体パッケージ用のフィルムキャリアなど種々の基 板上の電気的配線検査に適用でき、この明細書では、それら種々の配線基板を総 称して「回路基板」と称する。

[0002]

# 【従来の技術】

回路基板には、複数の配線からなる配線パターンが形成されており、配線パターンが設計通りに仕上がっているか否かを検査するために、従来より数多くの検査装置が提供されている。特に、近年、電子機器の小型化や軽量化などに伴って配線パターンのファイン化が進んでおり、全ての配線に直接プローブを接触させて配線の断線や短絡を検査することが困難となる場合があった。そこで、この方式の代わりに、微小なパッドには直接プローブを接触させずに、配線の断線等を検査する検査装置が提案されている。

[0003]

このような検査装置としては、例えば特許第3080158号公報に記載された装置がある。この装置は回路基板に形成された配線の断線/短絡を検査する装置であり、次のようにして検査を行っている。すなわち、この装置では、回路基板内部のGNDプレーンに繋がるGNDパッドに接触させるプローブが設けられており、電磁波照射手段によって検査対象配線に繋がるパッドに電磁波が照射されるように構成されている。そして、この検査装置は、電磁波を照射した際にG

NDパッドから流れる電流値をプローブを介して測定することによって、検査対 象配線の導通状態を検査することができる。

[0004]

# ^【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来技術においては、次のような問題があった。すなわち、従来技術においては、パッドに対して単に電磁波の照射を行っているにすぎないため、光電効果によってパッドから放出された電子は、再びそのパッドに戻ったり、他のパッドに散逸したりする。また、パッドから放出された電子が空間電荷領域を形成し、光電効果による電子放出効率を低下させる。したがって、従来技術によれば、光電効果により瞬間的に電子が放出されたとしても、それによって電流値を定常的に測定することは難しいため、このような構成の検査装置を用いて、回路基板に形成された配線の断線等を精度よく安定して検査することは困難である。

# [0005]

そこで、この発明は上記課題に鑑みなされたものであって、光電効果によって 生ずる電子を利用して回路基板に形成された配線の断線/短絡を精度よく安定し て検査することができる回路基板の検査装置および検査方法を提供することを目 的とする。

[0006]

### 【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明は、回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査装置であって、上記目的を達成するため、前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つの端子部を選択し、その選択された端子部に電磁波を選択的に照射する電磁波照射手段と、前記選択された端子部に近接して設けられた第1電極部と、前記選択された端子部を含む検査対象配線の少なくとも一部に近接して設けられ、前記検査対象配線と容量結合された第2電極部と、前記第1電極部と前記第2電極部との間に介揮され、前記第1電極部が前記第2電極部より高電位となるよう電位差を与える電源と、

前記第2電極部から前記電源へ流れる電流と前記電源から前記第1電極部へ流れる電流とのうちいずれか一方の電流を検出する電流検出手段と、前記電流検出手段によって検出された電流値に基づいて、前記検査対象配線の導通状態を判定する判定手段とを備えている。

# [0007]

このように構成された発明では、回路基板に形成された配線の1つについて、その配線の断線およびその配線と他の配線との短絡を検査することができる。すなわち、第1電極部と第2電極部との間に与えられた電圧により、端子部の近傍には第1電極部側に向かって高電位となる電界が形成されている。このとき、1つの端子部に電磁波を照射すると、光電効果によってこの端子部から電子が放出される。放出された電子は上記電界により第1電極部側に引き寄せられ、第1電極部に捕捉される。一方、この端子部とこれにつながる配線(本発明にいう「検査対象配線」に相当する)は第2電極部と容量結合しているため、電源から第1電極部、検査対象配線および第2電極部を経由して電源に戻る閉回路が形成されている。このため、上記電子の流れをこの閉回路に沿って流れる電流として検出することで、配線の導通状態を検査することができる。

# [0008]

以上のように、検査対象配線と第2電極部との間の容量が断線および短絡の有無によって変化することを利用し、その容量を介して流れる電流を検出しているので、非接触で配線の導通状態を検査することができる。そして、端子部に近接配置した第1電極部に高電位を与えているので、光電効果により放出された電子の端子部への戻りや他の端子部への散逸を防いで確実に第1電極部で捕捉することができ、そのため、精度よく安定して検査を行うことができる。

### [0009]

なお、検査対象配線と第2電極部とを容量結合させるにあたっては、その容量 をできるだけ大きく取ることが望ましい。というのは、容量が大きいほど電荷を 蓄積するために流れる電流が大きくなり、電流検出手段においてこの電流を検出 することが容易となるとともに、検査対象配線とその他の配線等との間に不可避 的に形成される浮遊容量の影響を受け難くなり、測定の精度および安定性を向上



させることができるからである。このためには、第2電極部の面積を大きく、また検査対象配線と第2電極部との間隔をできるだけ小さく取るのが望ましい。例えば、第2電極部を回路基板と同程度の寸法の導体板で構成し、回路基板をこの 導体板に直接あるいは薄い絶縁層を介して当接させる構成が考えられる。

# [0010]

また、請求項2に記載の発明は、回路基板の表面に形成された端子部と、前記゛ 回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている 導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査装置であって、上記目的 を達成するため、前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つを選択し、 その選択された第1選択端子部に電磁波を照射した後、前記第1選択端子部と異 なる別の端子部を選択し、その第2選択端子部に電磁波を照射する電磁波照射手 段と、前記第1および第2選択端子部に近接して設けられた第1電極部と、前記 第1選択端子部を含む第1検査対象配線の少なくとも一部と、前記第2選択端子 部を含む第2検査対象配線の少なくとも一部とに近接して設けられ、前記第1お よび第2検査対象配線のそれぞれと容量結合された第2電極部と、前記第1電極 部と前記第2電極部との間に介挿され、前記第1電極部が前記第2電極部より高 電位となるよう電位差を与える電源と、前記第2電極部から前記電源へ流れる電 流と前記電源から前記第1電極部へ流れる電流とのうちいずれか一方の電流を検 出する電流検出手段と、前記電流検出手段によって検出された電流値に基づいて 、前記第1および第2検査対象配線の間の導通状態を判定する判定手段とを備え ている。

# [0011]

このように構成された発明では、回路基板に形成された複数の配線のうち任意の2つの配線の間の短絡状態を検査することができる。すなわち、第1選択端子部に電磁波を照射すると光電効果により第1選択端子部は電子を放出して正に帯電し、最終的に第1選択端子部および第1選択端子部につながる配線(本発明にいう「第1検査対象配線」に相当する)の電位が第1電極部と同電位まで上昇する。このとき、第1検査対象配線と、第2選択端子部を含む配線(本発明にいう「第2検査対象配線」に相当する)とが短絡状態にあれば、第2検査対象配線は

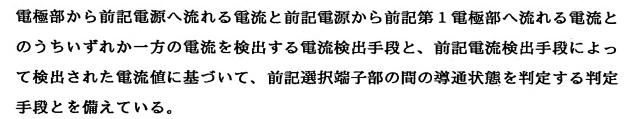
第1検査対象配線と同様に第1電極部と同じ電位となっている。この状態で電磁波の照射対象を第2選択端子部に切り替えると、第2検査対象配線の電位はすでに第1電極部と同電位となっているため、光電効果により第2選択端子部から放出された電子が電界によって引き寄せられて第1電極部へ流れ込むことはない。このため、電源から第1電極部、第2検査対象配線、第2検査対象配線と第2電極部との間に形成された容量および第2電極部を経由して電源に戻る閉回路に電流は流れない。一方、第1検査対象配線と第2検査対象配線とが短絡していなければ、第1選択端子部への電磁波照射によって第1検査対象配線の電位が上昇しても、第2検査対象配線の電位は変化しない。したがって、電磁波の照射対象を第2選択端子部に切り替えたとき、光電効果によって放出された電子は第1電極部側へ流れ、前述した閉回路に沿って電流が流れる。このことから、電磁波の照射対象を第1選択端子部から第2選択端子部に切り替えたときにこの回路に流れる電流を検出することで第1検査対象配線と第2検査対象配線との間の短絡状態を検査することができる。

# [0012]

以上のように、2つの検査対象配線の間の短絡状態を、電磁波の照射対象をそれぞれの配線につながる端子部の間で切り替えたときに回路に流れる電流の変化に基づいて判定しているので、配線の検査を精度よく安定して行うことができる

# [0013]

また、請求項3に記載された発明は、回路基板の表面に形成された複数の端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記複数の端子部を相互に電気的に接続する導電部とを含む検査対象配線が形成された回路基板の検査装置であって、上記目的を達成するため、前記複数の端子部のうち少なくとも2つの端子部を選択し、その選択端子部に順次、電磁波を選択的に照射する電磁波照射手段と、前記複数の選択端子部に近接して設けられた第1電極部と、前記検査対象配線の少なくとも一部に近接して設けられ、前記検査対象配線と容量結合された第2電極部と、前記第1電極部と前記第2電極部との間に介揮され、前記第1電極部が前記第2電極部より高電位となるよう電位差を与える電源と、前記第2



# [0014]

このように構成された発明では、回路基板に形成された複数の端子部の間の導通状態を検査することができる。すなわち、前述したように、第1の端子部を選択して電磁波を照射すると、この端子部と導通状態にある全ての配線および端子部の電位は第1電極部と同じ電位まで上昇する。ここで、電磁波の照射対象を第2の端子部に切り替えると、この端子部が第1の端子部と導通状態にあれば、第2の端子部の電位はすでに第1電極部と同じ電位まで上昇しており、前述の閉回路に電流は流れない。一方、これらの端子部の間が導通していなければ、低電位にある第2の端子部から放出された電子は第1電極部へ向かって流れ、その結果、第2の端子部およびそれにつながる配線と第2電極部とが作る容量を経由する閉回路に電流が流れる。したがって、この回路に流れる電流を検出することで、複数の端子部の間の導通状態を判定することができる。

# [0015]

以上のように、複数の端子部の間の導通状態を、これらの端子部に順次、電磁 波を照射したときに回路に流れる電流の変化に基づいて判定しているので、配線 の検査を精度よく安定して行うことができる。

### [0016]

また、請求項4に記載の発明は、少なくとも前記選択された端子部と前記第1 電極部の一部とを取り囲むチャンバをさらに備え、前記電磁波照射の前に前記チャンバ内の減圧処理が行われ、その減圧状態で前記電磁波が前記選択された端子部に照射されるべく構成されている。

#### [0017]

このように構成された発明では、前記閉空間の減圧処理が行われ、第1電極部 と端子部との間に存在する空気分子が低減されているため、光電効果による電子 放出が効率よく行われ、検査対象配線の断線/短絡をより精度よく安定して行う ことができる。さらに、チャンバは、端子部と第1電極部の少なくとも一部とを取り囲む、必要最小限の面積を覆うように構成されているため、減圧空間が小さくなり、その結果、装置の小型化および減圧処理を短時間に行うことができる。

# [0018]

さらに、この発明にかかる検査装置においては、装置の小型化等を図るために 、第1電極部がチャンバの一内側面をなすように構成してもよい(請求項5)。

# [0019]

また、第1電極部としては、透明電極やメッシュ電極を用いるのが好ましい( 請求項6および7)。というのも、光電効果により端子部から放出された電子を 第1電極部で確実に捕捉するためには、第1電極部を端子部にできるだけ近接さ せることが望ましく、第1電極部として透明電極やメッシュ電極を用いることに よって端子部との近接配置が可能となるからである。このうち、透明電極を用い るときには、透明電極を透過させて電磁波を端子部に照射することが可能である 。また、メッシュ電極を用いるときには、メッシュ電極の空隙部を通過させて電 磁波を端子部に照射することが可能である。

# [0020]

また、この発明にかかる検査装置は、前記第2電極部として、回路基板に予め設けられた前記検査対象配線以外の少なくとも1つの配線を用いる構成としてもよい(請求項8)。第2電極部は、外部電源と電気的に接続されており、かつ検査対象配線と容量結合していることがその要件であるが、前述の通り、検査の精度および安定性を向上させるためにはこの容量ができるだけ大きいことが望ましい。このためには、第2電極部と検査対象配線とができるだけ近接していることが望ましく、回路基板内にあって検査対象配線に近接して設けられた配線を導電プローブ等で電源と接続して第2電極部として機能させることは有効である。第2電極部としては、前記要件のとおり、外部に設けられた電源と電気的に接続することができ、その占める面積が大きく他の配線との結合容量が大きい配線を用いることが好ましい。その点で、回路基板に広い面積で形成され他の配線との間の容量が大きい電源あるいはグラウンド配線は第2電極部として機能させるに好適である。また、第2電極部が検査対象配線と同一の回路基板内に設けられるこ

とで、検査対象配線と第2電極部との位置関係が確定するのでこれらの間の容量が安定し、その結果、検査の精度および安定性が向上するという利点もある。特に、電源あるいはグラウンド層が回路基板の広い面積を覆って設けられた多層基板においては、この電源あるいはグラウンド層を第2電極部として機能させることはきわめて有効である。

# [0021]

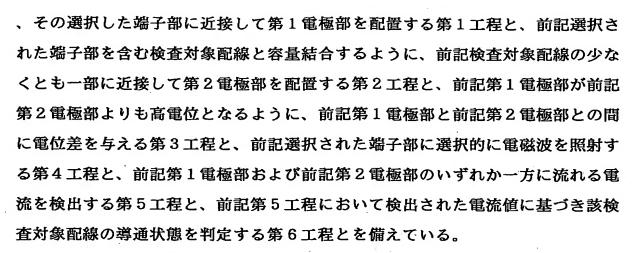
また、この発明にかかる検査装置は、前記第1電極部として、回路基板に形成された配線のうち前記検査対象配線以外の少なくとも1つの配線を用いる構成としてもよい(請求項9)。このように構成された発明では、第1電極部として選択した配線を電源に接続して高電位を与えることで、検査対象配線の端子部から放出された電子をこの第1電極部として選択した配線の端子部で確実に捕捉することができる。このように、この発明にかかる検査装置は、第1電極部を設ける必要がなく、構成が簡単となり装置の小型化が可能となる。

# [0022]

さらに、この発明にかかる検査装置は、前記第1、第2電極部として、それぞれ前記検査対象配線以外の少なくとも1つの配線を用いる構成としてもよい(請求項10)。このように構成された発明では、第1、第2電極部として選択された配線の間に電圧が印加されてこれらの間に電界が形成されており、電磁波照射によって検査対象配線の端子部から放出された電子が第1電極部として選択された配線の端子部に流れてこの配線に捕捉される。一方、この電子の流れに呼応して、検査対象配線と第2電極部として選択された配線との間の容量を介して電流が流れて電流検出手段に検出される。このように、第1、第2電極部として選択された配線がそれぞれの電極部としての機能を果たすので、前述の装置と同様に、配線の検査を精度よく安定して行うことができる。

### [0023]

また、請求項11に記載の発明は、回路基板の表面に形成された端子部と、前 記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されてい る導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査方法であって、上記目 的を達成するため、前記回路基板の表面に形成された端子部のうち1つを選択し



# [0024]

この検査方法では、回路基板に形成された端子部に電磁波を照射して、その端子部を含む検査対象配線の断線および該検査対象配線と他の配線との短絡について検査を行っている。すなわち、電磁波を照射される端子部に近接して配置した第1電極部に高電位を与えており、一方、検査対象配線と第2電極部とを容量結合させている。そして、端子部に電磁波を照射したときに発生する電子を第1電極部で捕捉するとともに、容量を介した閉回路に流れる電流としてこの電子の流れを検出しているので、この容量に蓄積された電荷を確実に測定することができる。そして、この測定された電荷量に基づいて配線の断線/短絡を判定しているので、この発明にかかる検査方法は、上記装置と同様に、配線の検査を精度よく安定して行うことができる。

#### [0025]

また、請求項14に記載の発明は、回路基板の表面に形成された端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記端子部と電気的に接続されている導電部とを含む配線が複数個形成された回路基板の検査方法であって、上記目的を達成するため、前記回路基板の表面に形成された端子部のうち2つを選択し、それら第1および第2選択端子部に近接して第1電極部を配置する第8工程と、前記第1選択端子部を含む第1検査対象配線と、前記第2選択端子部を含む第2検査対象配線とがそれぞれ第2電極部との間で容量結合するように、前記第1検査対象配線の少なくとも一部とに近接して前記第2電極部を配置する第9工程と、前記第1電極部が前記第2電極部

よりも高電位となるように、前記第1電極部と前記第2電極部との間に電位差を与える第10工程と、前記第1選択端子部に電磁波を照射する第11工程と、前記第1工程に続いて、前記第2選択端子部に電磁波を照射する第12工程と、前記電磁波の照射対象が前記第1選択端子部から前記第2選択端子部に切り替わるときに、前記第1電極部および前記第2電極部のいずれか一方に流れる電流を検出する第13工程と、前記第13工程において検出された電流値に基づき前記第1検査対象配線と前記第2検査対象配線との間の導通状態を判定する第14工程とを備えている。

[0026]

この検査方法では、1対の検査対象配線対の間の導通状態について検査を行っ ている。すなわち、第1の検査対象配線に含まれる第1の選択端子部と、第2の 検査対象配線に含まれる第2の選択端子部とに近接して第1電極部を配置し、一 方、これら第1および第2の検査対象配線のそれぞれと容量結合するように、第 2電極部を配置している。そして、第1および第2電極部との間に、第1電極部 が高電位となるような電圧を印加している。ここで、第1の選択端子部に電磁波 を照射すると、第1の選択端子部から電子が放出されて高電位の第1電極部へ流 れ、この端子部を含む第1検査対象配線は電荷を蓄積してその電位が上昇する。 次いで、第2の選択端子部に電磁波を照射する。このとき、第1および第2検査 対象配線の間が短絡していれば、第1の選択端子部への電磁波照射によって第2 検査対象配線はすでに電荷を蓄積してその電位が上昇しており、したがって、そ の後、第2の選択端子部に電磁波を照射しても、もはや電荷の移動は起こらない 。一方、第1および第2検査対象配線の間に短絡がなければ、第2の選択端子部 への電磁波照射によって、低電位にあるこの端子部から放出された電子は高電位 にある第1電極部に向かって流れ、電荷の移動が起こる。このように、2つの検 査対象配線の間の短絡の有無によって、電磁波照射対象を第1の選択端子部から 第2の選択端子部に切り替えたときの電荷の流れ方が異なる。そのため、第1あ るいは第2の電極部を流れる電流を計測してこの電荷の移動を把握することで、 2つの検査対象配線の間の短絡を検査することができる。

[0027]

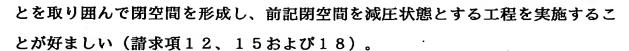
また、請求項17に記載の発明は、回路基板の表面に形成された複数の端子部と、前記回路基板の表面あるいは内部に形成されて前記複数の端子部を相互に電気的に接続する導電部とを含む検査対象配線が形成された回路基板の検査方法であって、上記目的を達成するため、前記回路基板の表面に形成された端子部のうち2つを選択し、それら第1および第2選択端子部に近接して第1電極部を配置する第16工程と、前記検査対象配線と容量結合するように、前記検査対象配線の少なくとも一部に近接して前記第2電極部を配置する第17工程と、前記第1電極部が前記第2電極部よりも高電位となるように、前記第1電極部と前記第2電極部との間に電位差を与える第18工程と、前記第1選択端子部に電磁波を照射する第19工程と、前記第19工程に続いて、前記第2選択端子部に電磁波を照射する第20工程と、前記電磁波の照射対象が前記第1選択端子部から前記第2選択端子部に切り替わるときに、前記第1電極部および前記第2電極部のいずれか一方に流れる電流を検出する第21工程と、前記第21工程において検出された電流値に基づき前記検査対象配線の導通状態を判定する第22工程とを備えている。

# [0028]

この検査方法では、回路基板の表面に形成された複数の端子部のうち2つの端子部を選択して、それらの端子部の間の導通状態を検査している。すなわち、この検査方法では、上記の検査方法と同様に、2つの端子部に順次、電磁波を照射して、電磁波の照射対象を切り替えたときの電荷の流れを検出して両端子部間の導通状態を判定している。そして、それらの端子部の間が本来導通しているべきか否かの情報に基づいて、配線の断線/短絡の有無を判定することができる。このようにして、回路基板表面に形成された複数の端子部の任意の組み合わせについて上記検査を行うことによって、回路基板に形成された配線の導通状態を検査することができる。

#### [0029]

また、これらの検査方法においては、放出される電子の障害となる空気分子を 低減して効率よい判定を行うために、少なくとも電磁波を放射する前に、電磁波 照射の対象となる1つあるいは複数の端子部と前記第1電極部の少なくとも一部



[0030]

さらに、これらの検査方法においては、上記検査装置と同様に、前記第2電極部として、回路基板に形成された配線であって電磁波照射の対象となる端子部を含まない少なくとも1つの配線を用いてもよい(請求項13、16および19)。このようにして検査を行うことによって、検査対象配線と第2電極部との位置関係が確定し、その間の容量が安定するので、その結果、検査の精度および安定性を向上させることができる。

# [0031]

# 【発明の実施の形態】

図1は、この発明にかかる回路基板の検査装置の、第1の実施形態を示す図である。また、図2はこの検査装置の電気的構成を示すブロック図である。この検査装置は、回路基板10を検査する検査装置である。この回路基板10では、図1に示すように、ベース基板11に複数の配線12が形成されている。各配線12は、回路基板10の表面に実装部品や外部配線と接続されるべく形成された端子部12a、12bと、回路基板10の表面あるいは内部に形成されてこれらの端子部を相互に電気的に接続する導電部12cとで構成されている。なお、この実施形態では、上記のように構成された回路基板10を検査対象たるワークとして検査する場合について説明するが、本発明の適用対象となる回路基板はこれに限定されるものでないことは言うまでもない。例えば、図1では回路基板10の両面に端子部12a、12bが設けられ、これらを接続すべく導電部12cがベース基板11の内部に形成されているが、端子部が回路基板の片面のみに形成され、回路基板表面に形成された導電部によってこれらが接続されているものであってもよい。

#### [0032]

この検査装置には、1枚の回路基板をワーク10として保持する下部治具40 が設けられている。下部治具40は、第2電極部として機能する金属板41と、 金属板41の上面に設けられた絶縁膜42と、これらを一体的に保持する下部治 具ベース45とから構成されている。金属板41はワーク10に形成された配線12との間に形成される容量を大とするためワーク10の下面をほぼ覆うように設けられている。そして、金属板41の上面には、絶縁膜42が設けられており、これによって、下部治具40がワーク10を密着保持した際に回路基板10の下面に形成された端子部12bと金属板41との絶縁が確保される。また、下部治具ベース45は下部治具駆動機構46と連結されており、装置全体を制御する制御部1から下部治具駆動機構46への制御信号により、ワーク10の検査を行うための検査位置(図1に示す位置)と、下部治具40へのワーク10の搬入および下部治具40からのワーク10の搬出を行うためのロード/アンロード位置(図示省略)との間を往復移動する。

# [0033]

また、検査位置には導電プローブ81が設けられており、上記した下部治具40の検査位置への移動により、この導電プローブ81と下部治具40に設けられた金属板41とが接触して、金属板41と後述する電源70との導通を確保する

# [0034]

なお、上記実施形態では、絶縁膜42は本発明の必須構成要件ではなく、例えばワーク10が片面に配線を有しないあるいは片面が被覆されている回路基板であれば、絶縁膜42を設けず金属板41と回路基板とを直接当接させてもよい。また、ワーク10が両面に配線を有する回路基板であっても、後に詳述するように、絶縁膜42を設けない構成の検査装置で検査を行うことが有効な場合がある

### [0035]

一方、検査位置に位置決めされるワーク10の上方には、上部治具50が配置されている。この上部治具50は、ワーク10の表面に形成された各端子部12aを覆うようにキャップ状に形成されて側面部に排気口54が設けられた、例えば石英ガラス製のチャンバ51と、チャンバ51のフランジ部分に取り付けられた例えばゴム製のパッキン52と、チャンバ51の内面上部に透明導電体にて形成されたプレート電極53とで構成されており、これらの構成要素51~54が

一体的にワーク10に対して接近/離間移動自在となっている。また、上部治具50には上部治具駆動機構56が連結されており、制御部1からの制御信号に応じて上部治具50をワーク10に対して接近/離間駆動する。

# [0036]

上記した上部治具50のワーク10への接近移動により、ワーク位置に位置決めされたワーク10と上部治具50は互いに押し付けられる形となる。このため、パッキン52がチャンバ51のフランジ部分とワーク10の表面との間に挟み込まれて弾性変形し、その結果、ワーク10、パッキン52およびチャンバ51の内面で取り囲まれる閉空間SPが形成される。

# [0037]

チャンバ51に設けられた排気口54は、排気管(図示省略)を介して排気装置90に連結されている。そして、制御部1からの制御信号によって排気装置90が作動すると閉空間SP内の空気が排出され、閉空間SP内が減圧状態となる

# [0038]

また、この検査装置においては、ワーク10に形成された複数の配線12のうち、検査対象となる1つの配線につながる端子部に電磁波を照射するための電磁波照射ユニット60が設けられている。この電磁波照射ユニット60は、制御部1からの制御指令にしたがって電磁波しを発射する電磁波発射部61と、電磁波発射部61から発射された電磁波しを制御部1からの制御指令にしたがってワーク10上の任意の位置に照射させる電磁波走査部62とを用いて構成されている。このように、この実施形態では、電磁波照射ユニット60が本発明にいう「電磁波照射手段」として機能している。

#### [0039]

本実施形態において、電磁波発射部 6 1 は、光電効果の効率の面から紫外線を発射する装置が用いられているが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、必要に応じて可視光線や赤外線等を用いてもよい。また、この電磁波発射部 6 1 は、Qスイッチ素子等を用いてパルス駆動が可能であるように構成されている。さらに、電磁波Lの走査を行う電磁波走査部 6 2 は、ガルバノミラーを用いて

構成されている。そして、本実施形態にかかる電磁波照射ユニット60においては、制御部1からの動作指令に基づきガルバノミラーを駆動させることにより、電磁波発射部61から発射された電磁波Lを、ワーク10の表面の任意の箇所に正確かつ高速に照射することができる。

# [0040]

また、この検査装置では、プレート電極53と金属板41との間に電位差を与える直流電源70が設けられており、この電源70は制御部1からの制御指令にしたがって所定の電圧を出力する。この実施形態にかかる検査装置では、このように電位差を与えることによって、後に詳述するように、光電効果によって生ずる電子の戻りや散逸、さらには空間電荷領域の形成を抑制し、測定を効率的に行うことができる。

# [0041]

また、この検査装置では、電源70の一方端子からプレート電極53、検査対象配線および金属板41を介して電源70の他方端子に戻る導電経路に電流検出部80が介挿されて、当該導電経路を流れる電流を検出する。具体的には、電源70のプラス側端子がプレート電極53と電気的に接続され、電源70のマイナス側端子が電流検出部80を介して導電プローブ81に接続されている。導電プローブ81は、下部治具40およびワーク10が検査位置にあるとき金属板41と接触しており、こうして上記導電経路が形成される。

### [0042]

そして、本実施形態において、電源70からの電圧がプレート電極53と金属板41との間に印加された状態では、金属板41からプレート電極53に向かって電位が高くなるような電界が発生している。この状態で端子部12aに電磁波Lが照射されると、端子部12aでは光電効果が起こり電子が放出される。こうして放出された電子は上記電界によりプレート電極53側に引き寄せられ、従来技術のように放出された電子が再びその端子部に戻ったり、他の端子部等に散逸したり、さらには、放出された電子が空間電荷領域を形成して光電効果による電子放出効率を低下させることがない。一方、配線12は金属板41との間で容量を形成しているため、配線12側で光電効果によって電子が放出されてプレート

電極53に捕捉され、電源70のプラス側端子に流れると、電源70のマイナス側端子から電流検出部80および導電プローブ81を経由して金属板41にこれと同量の電子が流れ込む。このようにして、電源70のプラス側端子からプレート電極53、配線12、金属板41、導電プローブ81および電流検出部80を経由して電源70へ戻る導電経路が形成され、この導電経路に沿って流れた電流が電流検出部80で検出される。電流検出部80によって検出された電流値は、A/D変換回路81によってデジタル信号に変換されて制御部1に送られる。このように、本実施形態においては、プレート電極53、金属板41および電流検出部80が、それぞれ本発明の「第1電極部」、「第2電極部」および「電流検出手段」として機能している。

# [0043]

なお、この実施形態では、電流検出部80は電源70のマイナス側端子と導電 プローブ81との間に介挿されているが、これ以外にも上記導電経路に流れる電 流を検出することができる構成であれば、例えば電源70のプラス側端子とプレ ート電極53との間に設ける構成としてもよい。

#### [0044]

ここで、例えば図1に示すように、ワーク10に形成された配線12のうちの1つの配線121を構成する端子部121aに電磁波Lが照射された場合について検討する。この場合、配線121が本発明の「検査対象配線」に相当することになる。このとき、検査対象配線121が正常な導通状態にあるとき、配線121および金属板41は、端子部121a、121aaおよび121cを一方極板とし、金属板41を他方極板とするキャパシタを形成している。

#### [0045]

端子部121aに電磁波Lが照射されると、光電効果によって端子部121aから電子が放出される。この電子は電界によってプレート電極53に引き寄せられて捕捉され、電源70のプラス側端子へと流れる。そして、電子を放出したことにより配線121には正の電荷が蓄積される。一方、配線121とキャパシタを形成している他方極板、すなわち金属板41には負の電荷、すなわち電子が電源70のマイナス側端子から供給されて蓄積されている。このように、端子部1

21 aへの電磁波照射によって、上記導電経路に電流が流れ、配線121と金属板41とが成すキャパシタには電荷が蓄積される。

# [0046]

このときの配線121の電位、電流検出部80に流れる電流および電流を積算して求まる電荷量の変化は、それぞれ例えば図3に示す各グラフの波形aのようになる。図3は、電磁波照射の前後における検査対象配線の電位、上記導電経路に流れる電流およびこの導電回路に流れて上記キャパシタに蓄積される電荷量の変化を示す図である。電磁波Lを照射開始すると、端子部121aから放出された電子がプレート電極53へ引き寄せられることにより電流が流れるが、配線121が電子を放出するにつれてその電位は上昇し、そのため電流も次第に減少する。そして、配線121がプレート電極53と同電位となると、端子部121aから放出された電子がプレート電極53に引き寄せられることはなくなり、電流は停止する。このとき、電流検出部80に流れた電荷量Qoは、配線121と金属板41とがつくるキャパシタの容量をCo、電源70の出力電圧をVとすると

# Qo = CoV

となる。一方、配線121が、例えば図1に示す×部で断線していた場合、上記キャパシタの一方極板は、端子部121aと、導電部121cの×部までとを含む面積のみとなり、正常な配線より極板の面積が小さくなって、その結果、このときのキャパシタの容量は、上記した正常な配線の容量Coより小さな値となる。この状態で端子部121aに電磁波Lを照射したとき、配線121の電位、電流検出部80に流れる電流および電荷量の変化は、それぞれ例えば図3に示す各グラフの波形bのようになる。また、配線121が、例えば図1に示すy部で他配線122と短絡している場合、配線121および配線122が上記キャパシタの一方極板を構成することとなり、その容量は上記正常な配線の容量Coより大きな値となる。この状態で端子部121aに電磁波Lを照射したとき、配線121の電位、電流検出部80に流れる電流および電荷の変化は、それぞれ例えば図3に示す各グラフの波形cのようになる。このように、電流検出部80に流れる電荷量は、検査対象配線が断線しているときQoより小さく、また検査対象配線

が他の配線と短絡状態にあるときQoより大きくなる。

[0047]

制御部1は、電流検出部80で検出された電流値を時間積分することによってこのキャパシタに蓄積された電荷量Qを算出し、その値を予め求めた正常な配線に流れる電荷量と比較して、配線12の導通状態を判定する。このように、本実施形態においては、制御部1が本発明にいう「判定手段」として機能している。

[0048]

次に、この検査装置の動作について、図4を参照しつつ以下に説明する。図4は、図1に示す検査装置の動作を示すフローチャートである。この検査装置では、ロード/アンロード位置に位置している下部治具40に対して未検査のワーク(回路基板)10が検査装置に並設されたハンドリング装置(図示省略)やオペレータのマニュアル操作などによってローディングされる(ステップS1)と、制御部1が装置各部を制御し、以下のステップS2~S11を実行してワーク10を検査する。

[0049]

ワーク10が下部治具40にローディングされると、下部治具40はワーク10を保持したまま検査位置に移動する(ステップS2)。こうしてワーク10が検査位置に位置決めされるとともに、金属板41が導電プローブ81と接触して電流検出部80に接続される。

[0050]

それに続いて、上部治具50がワーク10に向かって接近移動し、下部治具40との間にワーク10を挟み込んで固定する(ステップS3)。その結果、チャンバ51、パッキン52およびワーク10に取り囲まれる閉空間SPが形成される。その後、排気装置90が作動して、閉空間SP内を所定の気圧まで減圧する(ステップS4)。そして、電源70が所定の直流電圧を出力し、プレート電極53および金属板41の間にその電圧を印加する(ステップS5)。

[0051]

こうしてワーク10の検査準備が完了すると、配線検査(ステップS6)を実行して配線の導通状態を検査する。なお、この検査内容については後で詳述する

# [0052]

そして、検査が終了すると、電源70が電圧出力を停止し(ステップS7)、 排気装置90が停止した後、外気がSP内に導入される(ステップS8)。それ に続いて、上部治具50がワーク10から離間移動した後(ステップS9)、下 部治具40がロード/アンロード位置へ移動する(ステップ10)。最後に、ス テップS11で検査が完了したワーク10が搬出されたことを確認すると、ステ ップS1に戻って上記一連の処理を実行する。

### [0053]

次に、配線検査(ステップS6)について、図5を参照しつつ以下に詳述する。図5は、この発明にかかる検査装置における配線検査を示すフローチャートである。

### [0054]

ステップS5までの処理により、チャンバ51とワーク10とで取り囲まれる 閉空間SP内は所定の気圧まで減圧されており、一方、プレート電極53と金属 板41との間には電圧が印加されてプレート電極53側が高電位となる電界が発 生している。この状態で、制御部1が配線121を検査対象として選択すると、 電磁波照射ユニット60がこの配線121を構成する端子部121aに向けて電 磁波を照射する(ステップS61)。このとき、光電効果によって端子部121 aから放出された電子が上記電界によりプレート電極53に引き寄せられること で電流が流れる。この電流を電流検出部80で測定する(ステップS62)。そ して、所定の時間が経過するまで測定を行った後(ステップS63)、制御部1 が、電流検出部80で検出された電流値から電荷量を算出する(ステップS64 )。具体的には、検出された電流値を時間積分することによって電荷量Qを算出 する。そして、この電荷量Qに基づいて、制御部1が検査対象配線121の導通 状態を判定する(ステップS65)。すなわち、実測によって求められた、検査 対象配線に蓄積された電荷量Qの値が、正常な導通状態にある配線において予め 求めた電荷量Qoを中心値とした所定の許容範囲内にあれば配線121は正常な 導通状態にあると判定する。一方、Qがこの許容範囲の下限未満であれば配線1

21は断線していると判定する。また、Qがこの許容範囲の上限より大きければ 、配線121は他配線と短絡していると判定する。

[0055]

こうして、1つの検査対象配線についての検査が終了する。そして、全ての配 線の検査が終了するまで、上記一連の検査が繰り返して実行される(ステップ S 6 6 ) 。

[0056]

以上のように、この実施形態にかかる検査装置では、検査対象配線につながる 端子部に電磁波を照射して光電効果を生じさせ、この端子部に近接して配置した 第1電極部たるプレート電極53に高電位を与えることで放出された電子を引き 寄せて確実に捕捉する。一方、第2電極部たる金属板41をワーク10に対向配 置して検査対象配線と容量結合させているが、この容量は検査対象配線の導通状態によって変化するため、蓄積される電荷量もこれに伴って変化する。この容量 を介して流れる電流を検出してこの蓄積された電荷量を求め、その値に基づいて 配線の断線/短絡を判定しているので、回路基板に形成された配線の検査を、非 接触にて、しかも精度よく安定して行うことができる。

[0057]

ところで、上記の実施形態においては、選択された1つの端子部に電磁波を照射したときに電流検出部に流れる電荷量に基づいて、この端子部につながる検査対象配線の断線および当該検査対象配線と他配線との短絡を検査しているが、この検査装置は、上記した検査の手順を一部変更することで、2つの端子間あるいは2つの配線の間の導通状態を検査することも可能である。図6は、このような検査を可能とする本発明にかかる検査装置の第2の実施形態の配線検査を示すフローチャートである。また、図7は、電磁波照射の前後における各端子部の電位、上記導電経路に流れる電流およびこの導電経路に流れて上記容量に蓄積される電荷量の変化を示す図である。なお、この実施形態にかかる検査装置の構成は図1と同一であるので、ここではこの実施形態による配線検査の動作について、図6のフローチャートを参照しつつ以下に説明する。

[0058]

この実施形態の配線検査では、まず1つの端子部、例えば図1に示す端子部121aを選択してこれに電磁波Lを照射する(ステップS611)。そして、所定時間が経過した後(ステップS612)、例えば時刻t1に、電磁波Lの照射対象を第2の端子部、例えば図1に示す端子部121aaに切り替える(ステップS613)とともに、所定の期間にわたって電流値を計測する(ステップS614およびS615)。ここで、第1の端子部121aと第2の端子部121a aとの間に導通がなければ、ステップS611での第1の端子部121aへの電磁波照射により第1の端子部121aから放出された電子が高電位のプレート電極53へ流れることによって電流が生じるとともに、第1の端子部121aの電位が上昇する。そして、その後、ステップS613で第2の端子部121aaに電磁波を照射すると、低電位にある第2の端子部121aaから高電位のプレート電極53に向かって電子の流れが生じる。このときの各端子部の電位、電流検出部80を流れる電流および電流を積算して求まる電荷量は、それぞれ例えば図7(a)のようになる。

# [0059]

一方、第1の端子部121aと第2の端子部121aaとが導通しているとき、ステップS611での第1の端子部121aへの電磁波照射によって端子部121aの電位が上昇すると、これと導通している第2の端子部121aaの電位も同じく上昇する。したがって、ステップS613で電磁波を第2の端子部121aaに照射しても、光電効果によって放出された電子をプレート電極53へ引き寄せる電界は形成されず、電子がプレート電極53に向かって流れることはないので、電流検出部80で検出される電流値はゼロあるいは上記の導通時の電流より大きく低下した値となる。このときの各端子部の電位、電流検出部80を流れる電流および電荷量は、それぞれ例えば図7(b)のようになる。

#### [0060]

こうして電流値の計測が終了すると、制御部1がその検出された電流値を時間 積分することによって電荷量Qの時間変化を算出し(ステップS616)、その 結果に基づいて両端子部の間の導通状態を判定する(ステップS617)。すな わち、実測によって求められた、電荷量Qの値が、図7(a)に示すように時刻 t1の前後で変化していれば、両端子部の間は導通なしと判定する。一方、Qの値が図7(b)に示すように時刻t1の前後で変化がなければ両端子部の間は導通していると判定する。こうして、1つの検査対象配線についての検査が終了する。そして、全ての配線の検査が終了するまで、上記一連の検査が繰り返して実行される(ステップS618)。

# [0061]

なお、ここでは、図1に示すように、本来接続されているべき端子部121a、121aaの間について検査を行う場合について説明した。この場合、端子部121a、121aa間に導通があれば正常、導通がなければ断線ありと判定される。一方、本来接続されていない端子部、例えば図1に示す端子部121a、122aを選択して上記検査を行う場合には、これらの端子部の間に導通がなければ正常、導通があれば両者の間が短絡していると判定する。このように、この実施形態の検査装置は、回路基板に形成された端子部の任意の組み合わせについてその導通状態を検査することで、配線の断線および短絡を検査することができる。

### [0062]

以上のように、複数の端子部に順次、電磁波を照射して、そのときに電流検出 部80に流れた電荷量の変化に基づいて、選択された端子間の導通を判定してい る。これらの端子部に近接してプレート電極53を配置して高電位を与え、放出 された電子を確実に捕捉できるように構成しているので、これらの任意の端子間 の断線/短絡を精度よく安定して検査することができる。

# [0063]

なお、本実施形態においては、電磁波照射対象を第2選択端子部に切り替えた ときに電流検出部80に流れる電流を計測しているが、これ以外にも、例えば、 第1選択端子部に電磁波を照射する前から電流を計測し、電荷を積算するように してもよい。

#### [0064]

また、これらの実施形態では、電流が流れ始めてから停止するまでを観測して 電流値を積分し電荷量Qを求める必要があるので、電磁波照射を開始してから所 定の計測時間にわたって電流を計測することで電荷の移動を確実に検出する方法 を採っているが、これ以外にも、例えば電流をモニタしてその大きさが所定の値 以下に減少するまで電流測定を続ける方法や、電流あるいは電荷量の変化分が所 定の値以下になるまで電流測定を続ける方法としてもよい。

# [0065]

また、これらの実施形態では、電流値を時間積分して電荷量Qを算出し、その 値によって配線の良否を判定しているが、これ以外にも、例えば電流のピーク値 を検出してその大小によって判定する方法や、電流が所定の値以下に低下するま での時間を計測する方法としてもよい。

# [0066]

また、第1の実施形態と第2の実施形態とを組み合わせて検査を行う構成としてもよい。例えば、第1の端子部に電磁波を照射してその端子部につながる配線の検査を行った後、この配線に断線あるいは短絡があると判定されたときのみ引き続いて他の端子部との間で導通検査を行う構成とすれば、多数の配線の検査を効率よく行うことができる。

### [0067]

さらに、先に述べたように、これらの実施形態において、ワーク10が両面に配線を有する回路基板であっても、絶縁膜42を設けない構成の検査装置で検査を行うことが有効な場合がある。というのは、このような回路基板を直接金属板41に接触させた場合には、回路基板の下面に形成された端子部12bが金属板41と電気的に接続されることでこの端子部12bにつながる配線12が本発明にいう第2電極部の一部として機能することになるからである。したがって、ワーク10が例えばその下面をグラウンド層とした回路基板や、内層に設けられたグラウンド層に接続される端子部が下面に設けられた回路基板等である場合、ワーク10と金属板41とを直接接触させることで、そのグラウンド層を第2電極部の一部として機能させることが可能となり、このとき検査対象配線と第2電極部との間の容量を大きく取ることが可能になって、この容量を流れる電流が大きくなって電流検出部80での検出が容易になる。さらに、検査対象となる配線と第2電極部との位置関係が確定するのでこれらの間の容量のばらつきが少なくな

り、検査の精度および安定性を向上させることができる。

[0068]

ところで、上に述べた2つの実施形態の検査装置は、金属板41を下部治具40に設けてワーク10と対向配置し、電源70に接続することで本発明の第2電極部として機能させているが、例えば、ワーク10が、配線が形成された複数の層を積層してなる多層基板である場合においては、検査対象配線と金属板41との間に他の配線や電源あるいはグラウンド層などが設けられているために検査対象配線と金属板41との間に十分な容量を形成させることができず、検査の精度および安定性が低下する場合がある。このような場合には、回路基板内に設けられた配線、例えばグラウンド層を第2電極部として機能させることによって、精度よく安定して配線の検査を行うことが可能となる。

[0069]

図8は、回路基板内に形成されたグラウンド層を第2電極部として機能させる ことを可能とした、この発明にかかる検査装置の第3の実施形態を示す図である 。この検査装置は、回路基板20を検査する検査装置である。この回路基板20 では、図8に示すように、ベース基板21に複数の配線22が形成されている。 配線22は、回路基板20の表面に形成された端子部22a、22bと、回路基 板20の表面あるいは内部に形成されてこれらの端子部と電気的に接続される導 電部22cとで構成されている。また、ベース基板21の内部には、回路基板2 0に形成される電子回路に動作基準となる電位を与えるためのグラウンド層23 が設けられている。グラウンド層23は、導電部22cが貫通している部分を除 いて回路基板20のほぼ全面を覆っており、また回路基板20の表面に形成され た端子部23aと接続されて、外部グラウンドと電気的に接続できるようになっ ている。なお、この実施形態では、上記のように構成された回路基板20を検査 対象たるワークとして検査する場合について説明するが、本発明の適用対象となり る回路基板はこれに限定されるものでないことは言うまでもない。例えば、グラ ウンド層23がメッシュ状に形成された導電体で構成されている回路基板につい ても、本発明を適用することができる。

[0070]

また、この検査装置では、下部治具40は図1の金属板41と絶縁膜42のかわりに、非導電性の保持台43で構成されている。これは、回路基板20の内部に形成されたグラウンド層23を第2電極部として機能させているために、下部治具40に大きな面積を持つ電極板を設ける必要がないからであるが、図1の検査装置と同じ構成としても同様に検査を行うことができる。

# [0071]

この検査装置においても、図1の検査装置と同様に、上部治具50がワーク20に向かって接近移動し、下部治具40との間にワーク20を挟み込んで固定することで、チャンバ51、パッキン52およびワーク20に取り囲まれる閉空間SPが形成されるように構成されているが、このときグラウンド層23につながる端子部23aがその閉空間SPの外部に位置するようにチャンバ51が構成されている。そして、上部治具50には導電プローブ57が設けられて、電流検出部80と接続されている。導電プローブ57は、検査位置に位置決めされたワーク20への上部治具50の接近移動に伴ってワーク20のグラウンド層につながる端子部23aと接触し、グラウンド層23と電流検出部80との導通を確保する。なお、この実施形態では、下部治具40と電流検出部80との間の導通を取る必要がないので、この目的で図1の検査装置において設けられていた導電プローブ81は設けられていない。上記以外の構成は図1の検査装置と同一であるので、同一の構成に対しては同一番号を付して説明を省略する。

### [0072]

この実施形態においては、グラウンド層23が導電プローブ57によって電流 検出部80に接続されており、一方、回路基板に形成された複数の配線22は、 グラウンド層23との間でそれぞれ容量結合している。このように、グラウンド 層23は、本発明の「第2電極部」としての要件、つまり外部電源と接続されて 、かつ回路基板内の検査対象となる配線と容量結合しているという条件を満たし ており、したがって、この検査装置は、グラウンド層23を第2電極部として機 能させることができる。

#### [0073]

この検査装置の動作は、以下の点を除き図1の検査装置の動作と同じである。

その相違点とは、光電効果に伴い流れる電流が、金属板41から導電プローブ81を通って電流検出部80へ流れるのでなく、グラウンド層23から導電プローブ57を通って電流検出部80へ流れる点である。その他の動作については、図1の検査装置の動作と同じである。したがって、先に述べた、第2電極部として金属板41を設けた検査装置と同様にして、検査対象配線の断線/短絡の検査および任意の端子部間の導通状態の検査を、精度よく安定して行うことができる。

#### [0074]

以上のように、この検査装置における配線の検査では、回路基板20内に設けられたグラウンド層23と各配線との間に形成される容量に蓄積される電荷量に基づいて配線の断線および短絡を判定している。このように、検査対象配線と第2電極部とが同一の回路基板に設けられているので、回路基板を下部治具にセットする際の位置ずれや、回路基板のそり、厚みのばらつき等によって生じる容量の変動がなく、その結果、精度よくかつ安定して配線の検査を行うことができる

# [0075]

なお、この実施形態では、グラウンド層23に接続される端子部23aが回路基板20の上面に形成された例について説明したが、ワーク20としては、これ以外の構造を有するものであっても、本実施形態を適宜改変することで本発明を適用することができる。例えば、回路基板20が下面にグラウンド端子を有する構造であれば、絶縁膜を設けない金属板41で下部治具を構成し、グラウンド端子と金属板41を接触させることでグラウンド層23を電源70に電気的に接続する構成や、ワーク20の下部から導電プローブ57をグラウンド端子に接触させる構成とすればよい。

### [0076]

また、本実施形態では、回路基板20の内層に設けられたグラウンド層を第2 電極部として機能させているが、これ以外にも、例えば、回路基板の片面のほぼ 全面を覆うように設けられたグラウンド面や、回路基板に設けられたグラウンド 以外の配線、例えば電源ラインとして設けられた配線を第2電極部として用いて もよい。

# [0077]

図9は、この発明にかかる検査装置の、第4の実施形態を示す図である。この 検査装置の構成および動作は、図1の検査装置と基本的に同じであるが、電圧の 印加方法が異なっており、これに伴って構成が一部相違しているので、ここでは 図1の検査装置との差異について説明し、同一の構成については同一の番号を付 して説明を省略する。

# [0078]

この検査装置は、回路基板30を検査する検査装置である。この回路基板30では、図9に示すように、ベース基板31に複数の配線32が形成されている。配線32は、回路基板30の表面に実装部品や外部配線と接続されるべく形成された端子部32a、32bと、回路基板30の表面あるいは内部に形成されてこれらの端子部に接続される導電部32cとで構成されている。なお、この実施形態では、上記のように構成された回路基板30を検査対象たるワークとして検査する場合について説明するが、本発明の適用対象となる回路基板はこれに限定されるものでないことは言うまでもない。

### [0079]

この検査装置においても、図1の検査装置と同様に、上部治具50がワーク30に向かって接近移動し、下部治具40との間にワーク30を挟み込んで固定することで、チャンバ51、パッキン52およびワーク30に取り囲まれる閉空間SPが形成されるように構成されているが、このとき複数の端子部322a、322aaを含む配線322の、1つの端子部322aがその閉空間SPの外部に位置する一方、配線322の他の端子部322aがその閉空間SP内部に配置するようにチャンバ51が構成されている。そして、上部治具50には導電プローブ58が設けられており、電源70のプラス側端子に接続されている。導電プローブ58は、検査位置に位置決めされたワーク30への上部治具50の接近移動に伴って端子部322aと電源のプラス側端子とを電気的に接続し、これによって、この端子部322aにつながる配線322に接続されて閉空間SP内に形成されている端子部322aaの近傍には電界が発生して

いる。そして、制御部1が配線321を検査対象として選択し、電磁波照射ユニット60がその配線321を構成する端子部321aに電磁波Lを照射すると、この端子部321aから放出された電子はこの電界によって端子部322aaに引き寄せられて捕捉され、導電プローブ58を通って電源70に流れる。一方、検査対象配線321と容量結合している金属板41には、上記の電子の流れに伴って電源70から電流検出部80および導電プローブ81を経由して電子が流れ込み、その電流が電流検出部80にて検出される。したがって、先に述べた検査装置と同様にして、この検査装置で配線の検査を行うことができる。

# [0080]

以上のように、この実施形態にかかる検査装置では、回路基板30に形成された配線322の一方端子部322aが閉空間SP外に、他方端子部322aaが閉空間SP内に配置されるように上部治具50が構成されており、導電プローブ58によって一方端子部322aを電源70に接続することで、配線322を本発明の「第1電極部」として機能させている。その結果、図1の検査装置において設けられていたプレート電極53を設ける必要がなくなり、チャンバ51はワーク30の表面の検査すべき端子部を覆う最小限の面積に構成すればよいので装置の小型化を図ることができるとともに、減圧すべき閉空間SPの容積を小さくすることができ、減圧に要する時間を短縮して短時間にて配線の検査を行うことができる。

### [0081]

また、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形態では、チャンバ内を減圧処理する場合について説明したが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、必要に応じて、減圧処理を行わず、あるいは減圧状態を適宜加減してもよい。また、これらの実施形態では、回路基板表面の電磁波照射対象となる端子部を覆うようにチャンバを構成しているが、この他にも、例えば、チャンバの外縁と下部治具の外縁とが当接して密閉空間を形成し、回路基板全体をその内部に収容して減圧する構成としてもよいし、また、回路基板および下部治具全体を収容するようなチャンバを設けてこれら全

体を減圧する構成としてもよい。

[0082]

さらに、これらの実施形態を適宜組み合わせて実施することも可能である。例 えば、上述した第3の実施形態と第4の実施形態を組み合わせて、例えば、ワー クとなる回路基板に形成された電源配線を本発明の第1電極部として機能させる とともに、回路基板に形成されたグラウンド層を本発明の第2電極部として機能 させて配線の検査を行うことも可能である。

[0083]

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、検査対象配線につながる端子部に近接して配置した第1電極部に高電位を与えているので、光電効果によって端子部から放出された電子を第1電極部が引き寄せて確実に捕捉することができる。一方、検査対象配線と容量結合するよう第2電極部を配置しているので、上記電子の流れを、この容量を介した閉回路に沿って流れる電流として確実に検出することができる。そして、この電流値に基づいて配線の検査を行うようにしているので、検査対象配線の断線/短絡の検査を非接触で、しかも精度よく安定して行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明にかかる検査装置の第1の実施形態を示す図である。

【図2】

この検査装置の電気的構成を示すブロック図である。

【図3】

電磁波を照射したときの配線の電位・電流・電荷量の変化を示す図である。

【図4】

この検査装置の動作を示すフローチャートである。

【図5】

この検査装置における配線検査を示すフローチャートである。

【図6】

この発明にかかる検査装置の第2の実施形態の配線検査を示すフローチャートである。

## 【図7】

第2の実施形態において電磁波を照射したときの配線の電位・電流・電荷量の 変化を示す図である。

#### 【図8】

この発明にかかる検査装置の第3の実施形態を示す図である。

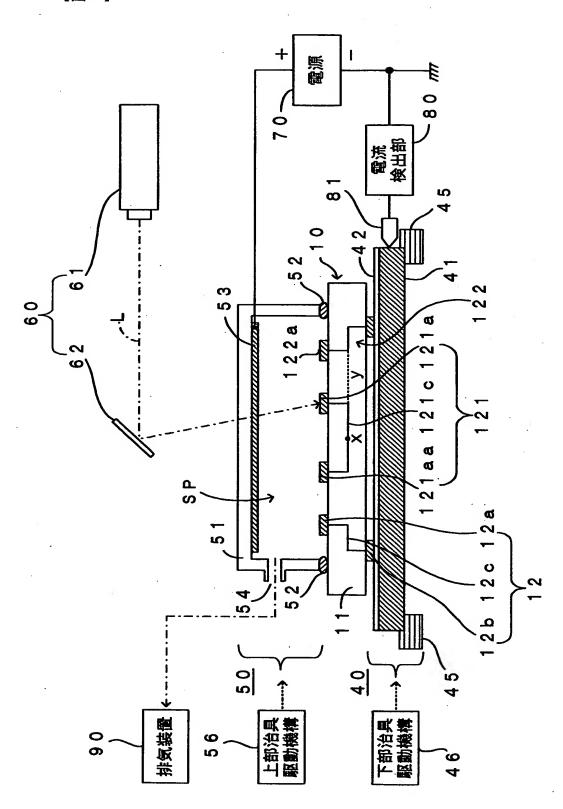
#### 【図9】

この発明にかかる検査装置の第4の実施形態を示す図である。

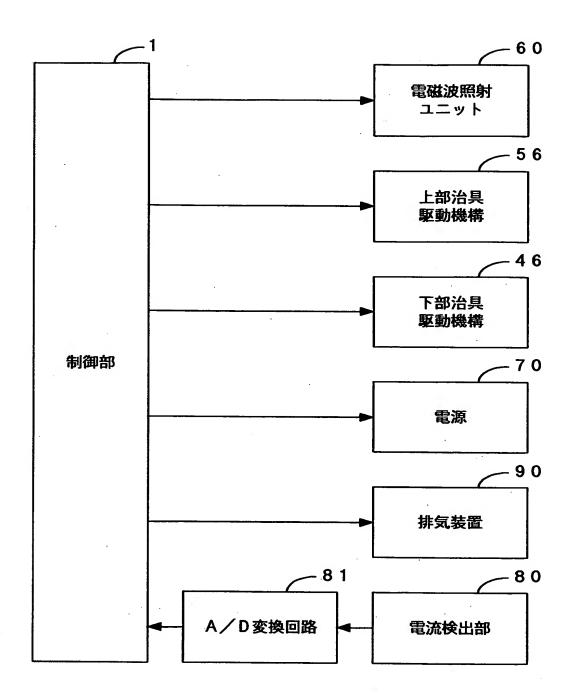
#### 【符号の説明】

- 10…ワーク(回路基板)
- 12、121…配線
- 12a、12b、121a、121aa…端子部
- 12c、121c…導電部
- 41…金属板 (第2電極部)
- 4 2 …絶縁膜
- 51…チャンバ
- 53…プレート電極(第1電極部)
- 60…電磁波照射ユニット
- 70…電源
- 80…電流検出部
- 81…導電プローブ
- SP…閉空間

【書類名】図面【図1】

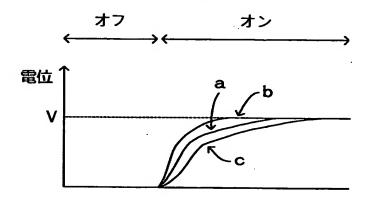


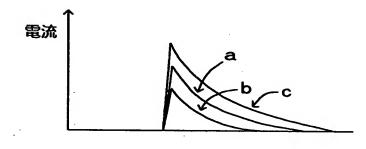
【図2】

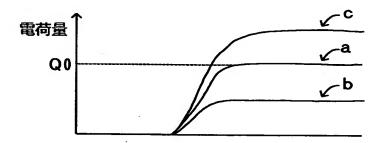


【図3】

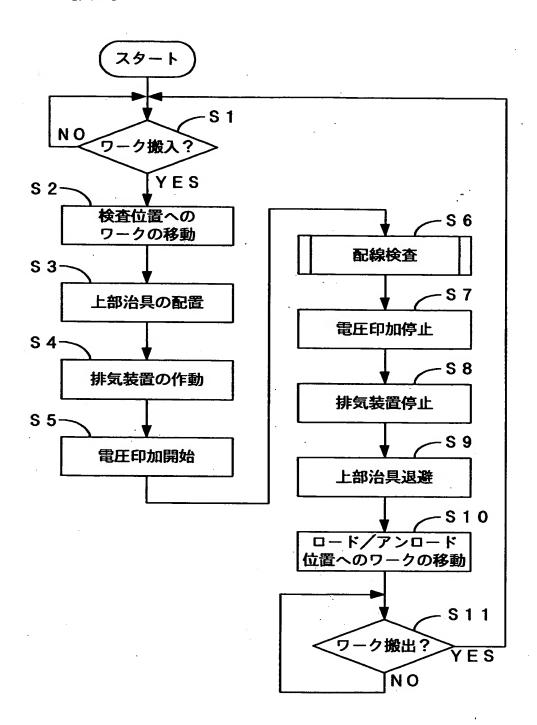
# 電磁波照射



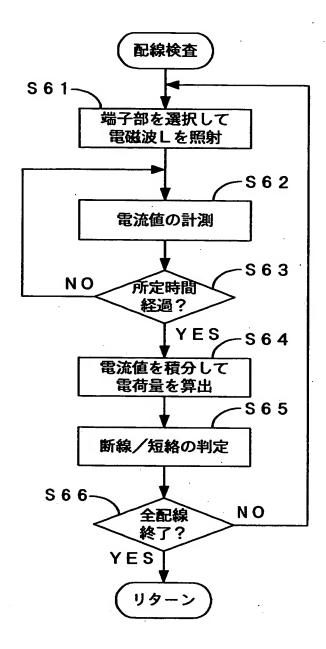




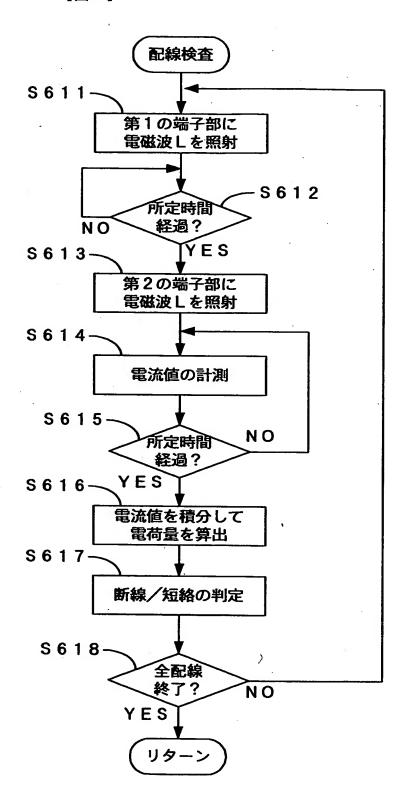
【図4】



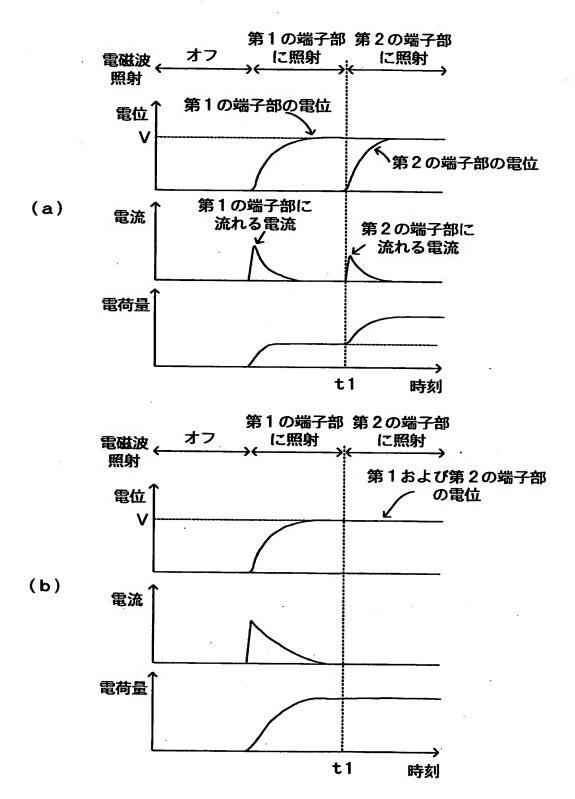
【図5】



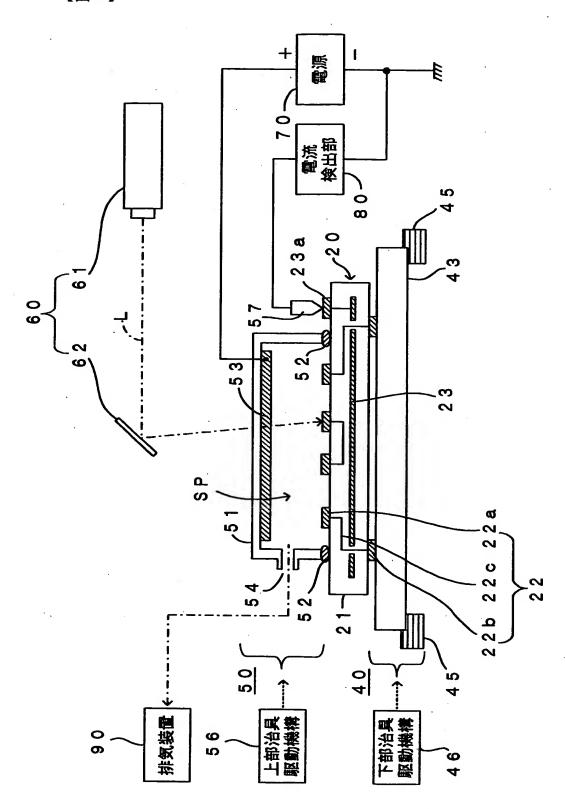
【図6】



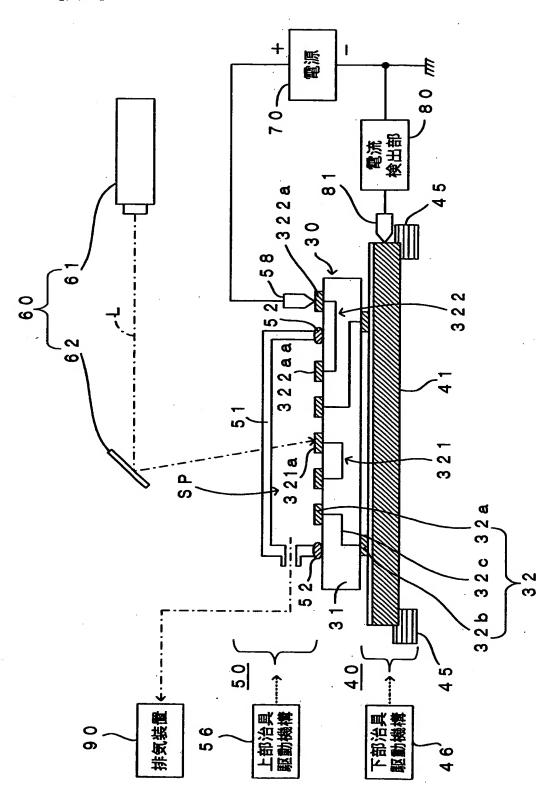
## 【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 光電効果によって生ずる電子を利用して回路基板に形成された配線の 導通状態を効率よく安定して検査することができる回路基板の検査装置および検 査方法を提供する。

【解決手段】 検査対象配線121につながる端子部121aに近接して配置したプレート電極53に高電位を与え、一方、検査対象配線121と容量結合するように金属板41を配置している。端子部121aに電磁波を照射すると、光電効果によって電子が放出され、配線121の断線/短絡の有無によって変化する上記容量には電荷が蓄積される。この電荷を検出して配線の導通状態を判定している。端子部121aから放出された電子はプレート電極53近傍に形成された電界によって引き寄せられるので、電子の端子部への戻りや散逸、空間電荷領域の形成を防止して確実に捕捉することができ、配線の断線/短絡の検査を非接触で、しかも精度よく安定して行うことができる。

【選択図】

図1

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2001-111132

受付番号

50100525603

書類名

特許願

担当官

第一担当上席 0090

作成日

平成13年 4月11日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成13年 4月10日

## 出願人履歴情報

識別番号

[392019709]

1. 変更年月日

1997年11月11日

[変更理由]

名称変更

住 所

京都府宇治市槙島町目川126番地

氏 名

日本電産リード株式会社